

(12) 特許協力条約に基づいて公開された国際出願

(19) 世界知的所有権機関
国際事務局

(43) 国際公開日
2025年3月6日(06.03.2025)



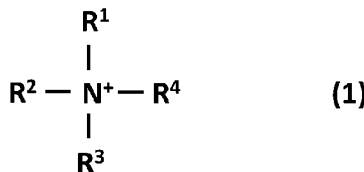
(10) 国際公開番号

WO 2025/047956 A1

- (51) 国際特許分類:
G03F 7/32 (2006.01) H01L 21/304 (2006.01)
C07C 211/63 (2006.01) H01L 21/306 (2006.01)
G03F 7/20 (2006.01) H01L 21/308 (2006.01)
G03F 7/26 (2006.01)
- (21) 国際出願番号: PCT/JP2024/031290
- (22) 国際出願日: 2024年8月30日(30.08.2024)
- (25) 国際出願の言語: 日本語
- (26) 国際公開の言語: 日本語
- (30) 優先権データ:
特願 2023-142385 2023年9月1日(01.09.2023) JP
特願 2024-017580 2024年2月8日(08.02.2024) JP
特願 2024-070675 2024年4月24日(24.04.2024) JP
特願 2024-077289 2024年5月10日(10.05.2024) JP
- (71) 出願人: 株式会社 トクヤマ (TOKUYAMA CORPORATION) [JP/JP]; 〒7458648 山口県周南市御影町1番1号 Yamaguchi (JP).
- (72) 発明者: 井上 裕史 (INOUE, Hiroshi); 〒7458648 山口県周南市御影町1番1号 株式会社トクヤマ内 Yamaguchi (JP). 川端 雄一郎 (KAWABATA, Yuichiro); 〒7458648 山口県周南市御影町1番1号 株式会社トクヤマ内 Yamaguchi (JP). 古澤 孝弘 (KOZAWA, Takahiro); 〒5650871 大阪府吹田市山田丘1番1号 国立大学法人大阪大学内 Osaka (JP). 汪 家豪 (WANG, Jiahao); 〒5650871 大阪府吹田市山田丘1番1号 国立大学法人大阪大学内 Osaka (JP).
- (74) 代理人: 弁理士 法人秀和 特許事務所 (IP FIRM SHUWA); 〒1050001 東京都港区虎ノ門五丁目11番2号 オランダヒルズ森タワー14階 Tokyo (JP).
- (81) 指定国(表示のない限り、全ての種類の国内保護が可能): AE, AG, AL, AM, AO, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BH, BN, BR, BW, BY, BZ, CA, CH, CL, CN, CO, CR, CU, CV, CZ, DE, DJ, DK, DM, DO, DZ, EC, EE, EG, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, GT, HN, HR, HU, ID, IL, IN, IQ, IR, IS, IT, JM, JO, JP, KE, KG, KH, KN, KP, KR, KW, KZ, LA, LC, LK, LR, LS, LU, LY, MA, MD, MG, MK, MN, MU, MW, MX, MY, MZ, NA, NG, NI, NO, NZ, OM, PA, PE, PG, PH, PL, PT, QA, RO, RS, RU, RW, SA, SC, SD, SE, SG, SK, SL, ST, SV, SY, TH, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VC, VN, WS, ZA, ZM, ZW.
- (84) 指定国(表示のない限り、全ての種類の広域保護が可能): ARIPO (BW, CV, GH, GM, KE, LR, LS, MW, MZ, NA, RW, SC, SD, SL, ST, SZ, TZ, UG, ZM, ZW). ユーラシア (AM, AZ, BY, KG, KZ, RU, TJ, TM), ヨーロッパ (AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LT, LU, LV, MC, ME, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR), OAPI (BF, BJ, CF,

(54) Title: PHOTORESIST DEVELOPING SOLUTION

(54) 発明の名称: フォトレジスト現像液



(57) Abstract: Provided is a photoresist developing solution comprising (A), (B), (C), and (D). (A) is a quaternary ammonium ion represented by formula (1), (B) is a halide ion, (C) is a hydroxide ion, and (D) is water. (In the formula, R^1 , R^{12} , R^3 , and R^4 are each independently a C1-16 alkyl group; at least one of R^1 , R^2 , R^3 , and R^4 is a C2-16 alkyl group; and not all of R^1 , R^2 , R^3 , and R^4 are the same alkyl group.)

(57) 要約: 下記 (A)、(B)、(C)、及び (D) を含む、フォトレジスト現像液。(A) 下記式 (1) で表される、第四級アンモニウムイオン (B) ハロゲン化物イオン (C) 水酸化物イオン (D) 水 (式中、 R^1 、 R^2 、 R^3 、及び R^4 はそれぞれ独立して、炭素数 1 ~ 16 のアルキル基であり、ただし、 R^1 、 R^2 、 R^3 、及び R^4 のうち、1 以上のアルキル基の炭素数が 2 ~ 16 であり、且つ R^1 、 R^2 、 R^3 、及び R^4 の全てが同一のアルキル基であることはない。)

[続葉有]

CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, KM, ML, MR, NE,
SN, TD, TG).

添付公開書類：

一 国際調査報告（条約第21条(3)）